

聚四氟乙烯平底烧瓶连续反应体系 耐氢氟酸 配滴液漏斗

货号: PL-CP357



简介

本款聚四氟乙烯平底烧瓶连续反应体系专为严苛化学合成设计，可完全耐受氢氟酸腐蚀。搭配标准磨口接口与集成滴液漏斗，支持定制化配置，可满足当前要求极高的工业与实验室应用，保障产物高纯度。

了解更多

应用场景	描述	核心优势
氢氟酸合成	处理化工生产中的含水氢氟酸和浓氟化物溶液	完全耐氢氟酸蚀刻，防止容器失效
半导体湿法蚀刻	混合调配硅晶圆加工用的高纯蚀刻剂	确保蚀刻剂中痕量金属污染极低
药物中间体生产	涉及腐蚀性催化剂的活性药物成分 (API) 连续流合成	无浸出，保证批次间重复稳定性
电池电解质研究	在惰性环境中制备锂离子电池盐和电解质溶剂	对有机碳酸盐和锂盐具备化学稳定性
痕量金属分析	使用强酸对地质或环境样品进行消解和前处理	背景值极低，适配ICP-MS和AAS分析
精细化工生产	特种聚合物和添加剂的大规模连续生产	结构坚固耐用，支持大体积工业生产
特性	规格详情 (PL-CP357系列)	
型号标识	PL-CP357 (基础配置)	
材质组成	100%原生高纯聚四氟乙烯 (可按需提供PFA/TFM)	
烧瓶类型	平底设计，保证稳定性，优化磁力搅拌效果	
反应容积	完全定制 (常用规格 : 100ml、250ml、500ml、1000ml、2000ml、5000ml)	
标准颈口尺寸	14/23、19/26、24/29、29/32、45/40 (CNC加工标准锥度)	
颈口配置	可提供单颈、双颈或多颈设计	
滴液漏斗类型	聚四氟乙烯滴液漏斗，配精密控制阀	
漏斗容积	可定制适配烧瓶容积 (例如50ml至1000ml)	
温度范围	-200°C 至 +260°C (-328°F 至 +500°F)	
压力等级	常压 (可提供定制增强设计适配真空/压力工况)	
耐化学性	完全耐受氢氟酸、盐酸、硫酸、硝酸和所有有机溶剂	
加工方式	全CNC加工，保证最高精度与表面光洁度	